## 06;07 Исследование прямых оптических переходов в монокристаллах кремния по спектрам пропускания

## © И.С. Панкратов, Р.П. Сейсян, А.А. Шорохов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург E-mail: vano85@bk.ru

## Поступило в Редакцию 5 марта 2012 г.

Экспериментально получен спектр пропускания монокристаллического Si в области 2.75–3.25 eV. Предложена эмпирическая формула, описывающая спектральную зависимость оптической плотности. Определена энергия прямого перехода в седловой точке  $E(\Gamma_{15}) - E(\Gamma_{25'}) = 3.43$  eV. Анализом спектральной зависимости показано, что наблюдаемое поглощение соответствует прямым переходам в сингулярность Ван Хова зоны проводимости  $M_1$ .

Как известно, кремний является основным материалом микроэлектроники, в частности вычислительной техники. С ростом производительности современных компьютеров встает проблема быстрой передачи информации даже в пределах одной микросхемы. Эта проблема может быть решена с развитием кремниевой фотоники. Необходимость интеграции транзисторов и элементов фотоники в одном кристалле требует создания оптоэлектронных приборов на основе кремния. Одним из направлений создания высокоэффективных источников излучения на основе кремния является разработка и исследование структур с размерным квантованием [1]. Так, фотолюминесценция и усиление света [2–4], а также электролюминесценция [5,6] обнаружены в кремниевых нанокристаллах, расположенных в матрице из SiO<sub>2</sub>.

1

Для расчета энергетических уровней нанокристаллов необходимы параметры зоны проводимости в Г-точке объемного монокристаллического кремния. Однако получение точных экспериментальных данных затруднено высоким значением коэффициента поглощения  $\sim 10^5~{\rm cm}^{-1}$  в области прямых оптических переходов. При исследовании спектров пропускания это приводит к проблеме изготовления достаточно тонких образцов.

Альтернативой эксперименту с пропусканием света является измерение спектров отражения. Так, с помощью соотношений Крамерса—Кронинга в работе [7] по спектрам пропускания были найдены оптические константы n и k, а также коэффициент поглощения  $\alpha$ кремния. Аналогичным образом в работе [8] была получена спектральная зависимость диэлектрической проницаемости. Однако этот метод является скорее косвенным, поэтому исследование более информативных спектров пропускания представляет большой интерес. В работах [9,10] коэффициент поглощения  $\alpha$  был измерен по спектрам пропускания тонких эпитаксиальных пленок кремния, выращенных на шпинели [9] и на сапфире [10] вплоть до 3.8 eV, т. е. существенно ниже предполагаемого края поглощения при прямых переходах в минимум зоны проводимости  $E_0$  (сингулярность Ван Хова  $M_0$ ).

Целью данной работы было исследование спектров пропускания объемного монокристаллического кремния. Для эксперимента использовались образцы высокоомного кремния с ориентацией (100). Анизотропным травлением на пластине были выполнены лунки диаметром около 1 mm. Дно таких лунок образовывало мембрану, которая уже после разделения пластины на отдельные образцы утончались в 20%-м водном растворе КОН с добавлением изопропилового спирта. Измерение толщины образцов контролировалось по спектрам пропускания, для чего использовалась экспериментальная установка, схематично изображенная на вставке рис. 1. В качестве источника света большой яркости, необходимой для работы с образцами высокой оптической плотности, была использована мощная ксеноновая лампа. Для предотвращения перегрева образца была выбрана обратная оптическая схема — свет от лампы, пройдя через монохроматор, фокусировался на образец и затем на катод фотоэлектронного умножителя. Регистрация фототока производилась в линейном режиме методом синхроного детектирования.

Полученный в ходе эксперимента сигнал содержит аппаратную функцию всей системы, поэтому смысл имеет только отношение сиг-



**Рис. 1.** Измеренный спектр пропускания образца. На вставке — схема экспериментальной установки: *1* — лампа ДКсШ-500, *2* — монохроматор МДР-23, *3* — оптический модулятор, *4* — образец Si, *5* — фотоумножитель ФЭУ-100, *6* — селективный нановольтметр, *7* — контроллер, *8* — ЭВМ.

нала с образцом к сигналу без образца, представляющее собой спектр пропускания (рис. 1). Заметим также, что мембрана образца имела большую неоднородность по толщине. В таком случае можно говорить лишь о некоторой эффективной площади, участвующей в пропускании света. Эта площадь, грубо говоря, равна площади самых тонких участков. Таким образом, правильное измерение интенсивности падающего света  $I_0$  становится невозможным, и коэффициент пропускания  $I/I_0$  может быть определен лишь с точностью до некоторого постоянного множителя.

Коэффициент поглощения, обусловленный межзонными переходами, в дипольном приближении можно записать как:

$$\alpha = \frac{4\pi^2 e^2 \hbar}{n c m^2} |P_{cv}|^2 \frac{1}{E} \rho(E), \qquad (1)$$

где *е*, *m* — заряд и масса электрона, *n* — коэффициент преломления среды,  $E = \hbar \omega$  — энергия фотона поглощаемого света,  $|P_{cv}|^2$  — квадрат матричного элемента дипольного перехода,  $\rho(E)$  — комбинированная плотность состояния [11]. Квадрат матричного элемента слабо зависит от энергии, поэтому зависимость коэффициента поглощения обусловлена главным образом множителем  $\rho(E)/E$ .

В кремнии Г-точка зоны проводимости считается точкой сингулярности Ван Хова  $M_1$ . Вблизи нее  $\rho(E)$  ведет себя как [11]:

$$\rho(E) = \begin{bmatrix} C_1 - \sqrt{E_1 - E}, & E < E_1 \\ C_1, & E > E_1, \end{bmatrix}$$
(2)

где  $E_1 = E(\Gamma_{15}) - E(\Gamma_{25'}), C_1$  — константа.

Для интенсивности прошедшего света имеем

$$I = (1 - R)^2 I_0 \exp(-\alpha d).$$
 (3)

Здесь d — толщина образца, R — коэффициент отражения (приближенно будем считать R и n постоянными), а множитель  $(1 - R)^2$  учитывает однократное отражение света от границ образца. С учетом неточности измерения  $I_0$  из (3) имеем

$$\alpha d = \ln\left(\frac{I'_0 \cdot C}{I}\right) + \ln(1-R)^2 = \ln\left(\frac{I'_0}{I}\right) - \ln(C) + \ln(1-R)^2.$$

Здесь  $I'_0 = I_0/C$  — измеренная интенсивность падающего света, C — постоянный множитель. Обозначив  $D' = \ln(I'_0/I)$ ,  $C_2 = \ln(C) - -\ln(1-R)^2$ , имеем

$$D' = \alpha d + C_2. \tag{4}$$

Таким образом, полученная экспериментально оптическая плотность D' отличается от настоящей на константу  $C_2$ . Подставляя  $\alpha$  из (1) в (4) и используя  $\rho(E)$  из (2), можем ввести эмпирическую формулу, аппроксимирующую D' при  $E < E_1$ :

$$D_{approx}(E) = A \frac{C_1 - \sqrt{E_1 - E}}{E} d + C_2,$$
 (5)

где

$$A = \frac{4\pi^2 e^2}{ncm^2} |P_{cv}|^2.$$



**Рис. 2.** Экспериментальная оптическая плотность D'(E) и аппроксимирующая функция  $D_{approx}$  (E) из (5).

Мы можем рассматривать  $C_1$ , d,  $C_2$  и  $E_1$  как параметры, которые могут быть найдены в результате подгонки  $D_{approx}$  к D'. На рис. 2 приведены экспериментальная кривая D' и подгонная к ней  $D_{approx}$ . Видно, что  $D_{approx}$  достаточно точно совпадает с D' вплоть до 3.25 eV. Отклонение D' при больших энергиях связано с ошибкой, вызванной низким уровнем сигнала, т.е. сильное поглощение света вблизи прямых переходов при доступной нам толщине образцов не дает возможности регистрировать спектры пропускания вплоть до самой  $E_1$ . Однако оказывается возможным определить  $E_1$  по доступному нам участку до 3.25 eV. Действительно, полученная в результате подгонки  $E_1 = 2.43$  eV достаточно точно совпадает с приведенными в [12] теоретическими 3.42–3.50 eV и экспериментальными 3.36–3.42 eV значениями энергии прямого перехода  $\Gamma_{25'} \rightarrow \Gamma_{15}$  в кремнии.

Так же для наглядности можно из (5) выразить

$$E_1 - E = \left(C_1 - \frac{E}{A} \left(D_{approx}(E) - C_2\right)\right)^2.$$
(6)



**Рис. 3.** Функция F'(E) и аппроксимирующая прямая.

В правую часть (6) подставим D' вместо  $D_{approx}$  и обозначим полученное выражение как F'(E). Очевидно, аппроксимацией для F'(E) будет являться прямая линия  $E_1 - E$ . Функция F'(E) приведена на рис. 3. На участке до 3.25 eV она действительно представляет собой прямую линию, продолжение которой пересекает ось E в точке 3.4 eV.

Таким образом, прямое измерение спектров пропускания подтверждает наличие сингулярности Ван Хова  $M_1$  в Г-точке зоны проводимости при 3.43 eV. Полученная кривая хорошо совпадает с экспериментом, что дает возможность определять энергию прямых переходов  $E_1$  по спектрам пропускания даже при отсутствии данных о толщине образца. Вопрос о расчете настоящего коэффициента поглощения и о положении  $E_0 = E_g$  для прямых переходов в минимум зоны проводимости остается открытым и представляет большой интерес для сравнения с результатами [9] и известными теоретическими расчетами.

## Список литературы

- Bahrm Jalali, Sasan Fathpour // J. Lightwave Technology. 2006. V. 24. N 12. P. 4600.
- [2] Pavesi L., Dal Negro L., Mazzoleni C., Franz'o G., Priolo F. // Nature. 2000.
   V. 408. N 6811. P. 440.
- [3] Ruan J., Fauchet P.M., Dal Negro L., Cazzanelli M., Pavesi L. // Appl. Phys. Lett. 2003. V. 83. N 26. P. 5479.
- [4] Гусев О.Б., Прокофьев А.А., Маслова О.А., Теруков И.Е., Ясиевич И.Н. // Письма в ЖЭТФ. 2011. Т. 93. В. 3. С. 162.
- [5] Irrera A., Pacifici D., Miritello M., Franzo G., Priolo F., Iacona F., Sanfilippo D., Stefano G.Di, Fallica P.G. // Physica E. 2003. V. 16. N 3/4. P. 395.
- [6] Walters R.J., Bourianoff G.I., Atwater A. // Nat. Mater. 2005. V. 4. N 2. P. 143–146.
- [7] Phillip H.R., Taft E.A. // Phys. Rev. 1960. V. 120. N 1.
- [8] Welkowsky M., Braunstein R. // Phys. Rev. B. 1972. V. 5. N 2. P. 497.
- [9] Phillip H.R. // J. Appl. Phys. 1972. V. 43. N 6. P. 2835.
- [10] Hulthen R. // Physica Scripta. 1975. V. 12. P. 342.
- [11] Питер Ю., Кардона М. Основы физики полупроводников. М.: Физматлит, 2002.
- [12] Landolt-Bornstein. New Series III/22a.